単一サイクル XFEL パルス生成手法の提案 PROPOSAL TO GENERATE MONOCYCLE XFEL PULSES

田中隆次

Takashi Tanaka*

RIKEN SPring-8 Center

Abstract

A new scheme for X-ray free electron lasers (XFELs) is presented, which makes it possible to generate an isolated monocycle X-ray pulse. This scheme is based on coherent emission from a chirped microbunch when passing through a strongly tapered undulator, and the pulse lengthening by optical slippage intrinsic to the lasing process of FELs, can be effectively suppressed through destructive interference of electromagnetic waves emitted at individual undulator periods. Numerical simulations show that an isolated monocycle X-ray pulse with the wavelength of 8.6 nm and the peak power of 1.2 GW can be generated if this scheme is applied to a 2-GeV and 2-kA electron beam.

1. はじめに

レーザー光を利用して超高速な現象を探索する際に 到達可能な時間分解能は、(ジッターなどの技術的要因 を除けば)レーザーのパルス幅で規定される。単一サイ クル光パルスとは、パルス幅が理論下限である波長程度 にまで圧縮された光である。単一サイクル光パルスの 生成は可視光や赤外領域では既に成熟した技術であり、 数フェムト秒という超短パルス特性を活かして様々な分 野における高速な現象が解明されている。

上記で述べた単一サイクル光パルスの生成技術が X 線領域におけるレーザーである XFEL においても適用 可能であれば、そのパルス幅は数アト秒から数 100 ゼ プト秒に到達し、これを利用することによって、従来の 長波長レーザーでは解明できない高速現象を研究する ことが期待される。一方、XFEL において到達可能なパ ルス幅は長波長レーザーと同等の数フェムト秒に留まっ ているのが現状である。

このような状況を打破し、XFELのパルス幅をさら に短縮するために各種のアイデアが提案されている^[1]-^[13]。また最近では、XFELパルスを実効的に圧縮する 原理^[14]や、数サイクルのパルストレインを発生する原 理^[15]などが提案され、注目を集めている。しかしなが ら、パルス幅を理論下限である波長程度にまで短縮し、 孤立した単一サイクル光パルスを発生する原理は存在 しない。

XFEL におけるレーザー発振の源はマイクロバンチ、 即ち、発振波長 λ で等間隔に並んだ密度変調である。 従って、レーザーのパルス幅 l_L はマイクロバンチの長 さ $l_b = M\lambda$ に強く依存する。ここで M は密度変調の数 を意味し、これを減らすことによってパルス幅を短縮す ることが可能である。容易に理解されるように、 l_b の最 小値は λ であり、このとき M は最小値 1 に達するとと もに、電子ビームにはただ 1 つのマイクロバンチ(単一 サイクルマイクロバンチ)が形成される。一方、そのよ うな極限状態においても、パルス幅 l_L は決して理論下 限 λ まで短縮することはできない。これは、電子ビー ムがアンジュレータの 1 周期を通過する間に、光パルス がアンジュレータの基本波長 λ だけ電子を追い越して いくためであり、これを光のスリッページと呼ぶ。具体 的には、単一サイクルマイクロバンチが形成された電子 ビームが N 周期のアンジュレータを通過する際に生成 するレーザーパルスは N サイクルに相当するパルス幅 を有する。即ち、スリッページにより XFEL のパルス 幅は広がってしまう。逆に言うと、単一サイクルマイク ロバンチが一度だけ偏向されると単一サイクル光パル スを生成するが、この条件では高出力なレーザー発振は 期待できない。本論文では、スリッページによるパルス 幅伸張効果を抑制し、多サイクルマイクロバンチを多周 期のアンジュレータに入射することで、高出力の単一サ イクル光パルスを発生する新たな XFEL 手法について 報告する。

2. 単一サイクルパルス発生の原理

本手法は、マイクロバンチの間隔が電子ビームの進行 方向に沿って直線的に変化すること、及びアンジュレー タの磁場振幅がある規則に従って変化すること、とい う点において通常の FEL 手法とは異なる。ここである 規則とは、n番目のマイクロバンチ間隔と、n周期目の 磁場振幅に相当するアンジュレータの基本波長とが等 しい、という条件を意味する。以後、間隔が直線的に変 化するマイクロバンチを「チャープしたマイクロバン チ」、また、磁場振幅が上記条件を満たすアンジュレー タを「テーパーアンジュレータ」と呼ぶ。これらを利用 して、単一サイクルパルスを発生する原理について Fig. 1を用いて解説する。

例として、11 サイクルのチャープしたマイクロバン チを有する電子ビームが上記の条件を満たすテーパー アンジュレータに入射する場合について考察する。電子 ビームの電流分布の模式図を Fig. 1(a) に示す。電流密 度 j が相対位置 $s = c(z/v_z - t)$ の関数として表されて いる。ここで、c, z, t 及び \bar{v}_z は光速度、進行方向座標、 時刻、及び電子の z 方向における平均速度を意味する。 n 番目のマイクロバンチ間隔は λ_n で示されており、こ れは n の増加に伴って直線的に減少する。以後、s の原 点は、最後尾に位置するマイクロバンチの電流ピーク位 置で定義し、破線で示す。

^{*} ztanaka@spring8.or.jp



Figure 1: Principle to generate a monocycle pulse in FELs.

上記で定義した電子ビームがアンジュレータの第1周 期を通過したときに形成する光の波形が Fig. 1(b)の赤 線で示されている。これは、電子ビームによって形成さ れる光電場の波形がその電流分布を反映すること、及 び光波がアンジュレータにおけるスリッページによって 電子ビーム前方にシフトするという効果を示している。 即ち、図中矢印で示したパルス(以後、共鳴パルスと称 する)が、原点から λ_1 (第1周期におけるスリッペー ジ長)だけ前方、即ち $s = \lambda_1$ に位置している。

次に、電子ビームが第2周期を通過した時点で形成される光の波形をFig.1(c)に示す。赤線は、第1周期通過後に形成された波形が、第2周期を通過する際のスリッページ効果によってさらに λ_2 だけ前方にシフトすることを示している。この結果、共鳴パルスは $s = \lambda_1 + \lambda_2$ に位置している。また青線で示した、第2周期を通過することによって形成される光波は、第1周期のそれとほぼ同じ形状であるが、最後尾のパルスは $s = \lambda_2$ に位置している。

同様の議論は、Fig. 1(d) 及び (e) に示した第 3 及び第 4 周期経過後の光波形にも適用され、共鳴パルスの位置 は $s = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3$ 及び $s = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 \land \mathcal{P}$ トし、さらに、各周期において形成された光波形が足し 合わされる。

Figure 1(f) に、全ての周期において放出された光の波 形を赤線で示す。共鳴パルスの位置では全ての波形が強 め合う状態(共鳴状態)で重ね合わされる一方、この位 置から離れた他の位置では共鳴条件は満たされず、波形 は弱め合う。これらを足し合わせると、赤の点線で示し たように、共鳴パルスの近傍においてピーク強度の高 い、パルス幅の短い光パルスを生成できることが理解で きる。

上で述べた議論は数学的には以下のように説明でき る。チャープしたマイクロバンチがテーパーアンジュ レータを通過したときに放出するコヒーレント光の電場 *E*(*t*) は次式で与えられる。

$$E(t) = n(t) \otimes E_s(t)$$

ここで、記号 \otimes はコンボリューション演算子であり、 $n(t) = n_0[1 + bf(t)]$ はチャープしたマイクロバンチの 密度分布関数、また $E_s(t) = E_0g(t)$ は単一の電子がテー パーアンジュレータを通過するときに放出する光の電場 を表す。さらに、関数 f(t) 及び g(t) はチャープした正 弦波関数、 n_0 は平均電子密度、b は $|b| \leq 1$ を満足する バンチ因子、 E_0 は電場振幅を意味する。

さて、n 番目の周期におけるアンジュレータの基本波 長が、n 番目のマイクロバンチ間隔 λ_n に等しいという 条件を思い出せば、関数 f(t) 及び g(t) に

$$g(t) = f(T - t) \tag{1}$$

なる関係が成り立つことが容易に理解される。ここで*T* は任意の時間である。時間*t*の原点を再定義することに より、次式が得られる。

$$E(t) = bn_0 E_0 \mathscr{F}^{-1}[|\tilde{f}(\omega)|^2]$$
(2)

ここで、 \mathscr{F}^{-1} はフーリエ逆変換を意味する演算子、また $\tilde{f}(\omega)$ はf(t)のフーリエ変換である。式(2)はE(t)が $|\tilde{f}(\omega)|^2$ の逆フーリエ変換で与えられることを意味する。 さて、 $|\tilde{f}(\omega)|^2$ はテーパーアンジュレータのスペクトルを表す関数であって、 ω に対して滑らかに変化するとともに、テーパー率に応じた広いバンド幅を有する。従ってそのフーリエ変換E(t)の時間幅、即ち光のパルス幅は、テーパー率に応じて縮小することが可能であり、究極的には単一サイクルパルスを生成することができる。

3. 実装方法

次に、上記で説明した単一サイクルパルス生成の原 理を XFEL ヘ実装する手法について解説する。本手法 は一般的に HGHG (High Gain Harmonic Generation) と 呼ばれる手法と類似しており、シード光をその高次光 にアップコンバートする。最大の違いは、シード光に単 一サイクルのレーザーパルスを利用する点にあり、出 力される高次光も単一サイクルに相当する短パルス特 性を維持する。このためこの手法を MCHG (Monocycle Harmonic Generation) と称する。Fig. 2 の上側に MCHG を可能にする加速器レイアウトの模式図を示す。

加速器を構成する各機器は、本手法が機能するため に必要な各プロセス毎に (i)~(v) の数字と矢印で示され たセクションに分類できる。以下で各セクションについ て解説するとともに、それぞれの入口と出口における電 流分布と光パルス波形の模式図を Fig. 2 の下側に示す。

セクション(i)では、単一周期のアンジュレータ(モ ジュレータ)とシケインが設置され、波長λ₀の単一サ イクルシード光によってエネルギー変調を誘起し、これ を密度変調に変換することによって単一サイクルのマ イクロバンチを電子ビームに形成する。この際、マイク ロバンチに強い高次成分が含まれることが、本手法が 有効に機能するために必要であり、このため、シード光 のピークパワーは十分に高いことが要求される。また、 シケインには以後の過程で必要の無いシード光を遮断

Proceedings of the 12th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan August 5-7, 2015, Tsuruga, Japan



Figure 2: Accelerator layout to realize the proposed MCHG scheme (top) and schematic illustration of the current profile and electric field of radiation seen at the entrances and exist of respective sections (bottom).

するためのシャッターが設置される。(a) に示した通り、 セクション(i) 入口において一様であった電子ビームの 電流分布は出口において強く変調され、単一のマイクロ バンチが形成される。さらに、このマイクロバンチには 強い高次成分が含まれる。

セクション(ii)において、単一サイクルマイクロバン チはテーパーアンジュレータ(ラディエータ)に入射 される。ここで、アンジュレータの偏向定数(K値)は $K[1+(\Delta K/K)\Delta z/L]$ に従って直線的に変化する。 Δz は、アンジュレータ中心からの相対距離であり、Lはア ンジュレータの全長を表す。平均偏向定数(K)は、ア ンジュレータ放射の中心波長が λ_0/m と等しくなるよう に調整する。ここで、mは目標となる高調次数である。 (c)に示した通り、セクション(ii)出口においてチャー プした光パルス(チャープパルス)が発生する。

セクション(iii)では、電子ビームはシケインを通過す る。これによって、セクション(i)で生成されたマイクロ バンチを消去するとともに、セクション(ii)で発生した チャープパルスを電子バンチ前方の"フレッシュな"領 域に送る。これはフ HGHG 型 FEL においてフレッシュ バンチとして知られる技法である。

セクション(iv)では、電子ビームは数周期のアンジュ レータ(モジュレータ)とシケインを通過する。セク ション(i)と同様の過程によってマイクロバンチが形成 されるが、電子ビームはチャープパルスと相互作用す るため、チャープしたマイクロバンチが形成される。ま た、チャープパルスは以後の過程では必要ないため、シ ケインには光を遮断するシャッターが挿入される。

セクション(v)において、チャープしたマイクロバン チを有する電子ビームがテーパーアンジュレータに入 射され、前節で解説した原理によって単一サイクルパル スを発生する。このセクションに設置されるテーパーア ンジュレータの仕様はセクション(ii)で利用されるもの と同じであるが、テーパーの方向が逆転している。こう することによって、式(1)で表される条件を担保するこ とができる。このようにして、波長 λ_0 の単一サイクル 光パルス(シード光)はその m 次高調波へアップコン バートされる。

上記の過程で得られた波長 λ_0/m の単一サイクルパ ルスが十分な強度を有する場合、これを次段の MCHG のシード光として利用することによって、さらなる短波 長化が可能である。これはカスケード型 HGHG として 知られる手法と同様である。

4. 適用例

前節で解説した MCHG の実現可能性と光源性能を調 べるため、数値計算による評価を行った。通常利用され る FEL シミュレーションコードでは、アンジュレータ 基本波長でのスライシングと、FEL 方程式のアンジュ レータ周期毎の平均化が行われるが、これらの数値計算 技法は MCHG の定量的評価には好ましくない。このた め、これらの技法を利用せずに FEL 方程式を解くため の計算コードを開発した。より実用に近い形での評価 とするため、光の回折や空間電化効果も考慮する一方、 電子ビーム及び光の空間分布を軸対称とすることで計 算時間の軽減を図った。

上記の計算コードを利用して、エネルギー 2 GeV、 電流 2kA、規格化エミッタンス 0.4 μ m の電子ビーム に MCHG を適用したときの光源性能についてシミュ レーションを行った。シード光として、文献^[19] で報告 されている、中心波長 60nm、パルスエネルギー 10 μ J、 FWHM パルス幅 0.38 fs の短パルス光を仮定した。シ ミュレーションは、数種類の高調次数 (m) と電子ビー ムのエネルギー幅 (σ_{γ}/γ) について行った。例として、 m = 7(λ_0/m =8.6 nm)、 σ_{γ}/γ = 5 × 10⁻⁵、及びテー パー率 $\Delta K/K$ = 0.5 を仮定したときの計算結果を Fig.



Figure 3: Simulation results for n = 7 (8.6 nm), $\sigma_{\gamma}/\gamma = 5 \times 10^{-5}$ and $\Delta K/K = 0.5$.

3 に示す。さらに、そのときに仮定したアンジュレータ 及びシケインのパラメータを Table 1 に示す。ちなみに この計算例では、光と電子の相互作用効率を増強するた めにヘリカルアンジュレータが利用されていることに注 意されたい。

Figure 3(a) 及び (b) には、2 段のテーパーアンジュレー タの入口における電流分布が示されている。横軸が相対 時刻 $\tau = s/c$ で表され、その原点はシードパルスがセク ション (i) の入口に到着した時刻で定義されている。ま た Fig 3(c) 及び (d) には、2 段のテーパーアンジュレー タ出口における光パワーと規格化された電場の時間分 布が示されている。

セクション (i) の出口において、ピーク電流 15 kA の 単一サイクルマイクロバンチが生成され (a)、これがテー パーアンジュレータを通過することによってチャープパ ルスが発生する(c)。このチャープパルスと電子ビームが 相互作用することによってチャープしたマイクロバンチ が形成され(b)、これが2段目のテーパーアンジュレータ を通過することによって、ピークパワー1.2GW、FWHM パルス幅 0.046 fs の光パルスが生成される(d)。このパ ルス幅は 8.6 nm の波長の 1.6 サイクルに相当する。

Table 1: Parameters for the undulator and dispersive sections assumed in Fig. 3; λ_u , N and K denote the period length, period number and K value of the undulators, and R_{56} denotes the dispersive strength.

Section	$\lambda_u(\text{mm})$	N	K	$R_{56}(\text{mm})$
(i)	170	1	3.13	0.015
(ii,v)	27	60	2.21~3.69	-
(iii)	-	-	-	0.20
(iv)	81	2	1.39	0.024

Figure 4(a) 及び(b) に、高調次数 m の関数として表 したピークパワーとパルス幅の計算結果を示す。エネル ギー幅として 3 種類仮定し、それぞれについてプロット してある。パルス幅は、サイクル数として規格化して示 している。また、電子エネルギーやアンジュレータの偏 向定数などは各計算条件において調整してあることに 注意されたい。

エネルギー幅が小さい場合 ($\sigma_{\gamma}/\gamma = 5 \times 10^{-5}$)、MCHG は上手く機能する。即ち、ピークパワーは 1GW に達し、 パルス幅は 9 次光 (6.7 nm) においても 2 サイクルより も短い。しかしながら、エネルギー幅が増加すると共に 短パルス性能やピークパワーと行った光源性能は急激に 悪化する。例えば、 $\sigma_{\gamma}/\gamma = 1.2 \times 10^{-4}$ のときには、現 在想定している条件において MCHG を実現することは ほぼ不可能である。

上記の問題を改善するため、2つの異なる方法が存在 する。一つは、セクション(iv)におけるアンジュレータ の周期数 (= $N^{(iv)}$)を増やすこと、他方はテーパーアン ジュレータのテーパー率 (Δ/K)を下げることである。 これらの修正はいずれもパルス幅を伸ばす方向に働く 一方、チャープしたマイクロバンチの形成を促進するた め、ピークパワーを大幅に改善する。例として、= $N^{(iv)}$ を 2 から 4 に増加し、 Δ/K を 0.5 から 0.2 に下げた時 の計算結果を Fig. 4(c) 及び (d) に示す。上記のパラメー タ調整により、ピークパワーが劇的に改善していること がわかる。ただしそれと同時にパルス幅が伸びており、 パラメータの選択には妥協が必要である。

5. まとめ

FEL における光のスリッページによるパルス幅の伸 張効果を抑制することによってパルス幅を制御し、原 理的には単一サイクルパルスを生成することが可能な、 新たな XFEL 手法について報告した。この手法の実現 性を探るため、軟 X 線領域において期待される光源性 能を数値計算により評価し、現実的なパラメータでも十 分な効果が得られることを確認した。一方この手法には 理論的な波長制限は無く、原理的には X 線領域にまで 拡張が可能であるため、SACLA などの XFEL 施設にお



Figure 4: Peak power (a,b) and pulse length (c,d) plotted as a function of m for different values of σ_{γ}/γ .

いて、単一サイクル X 線レーザーを実現するための有 力なオプションとして期待される。

参考文献

- [1] E. L. Saldin, E. A. Schneidmiller, and M.V. Yurkov, Opt. Commun. 212, 377 (2002).
- [2] P. Emma, K. Bane, M. Cornacchia, Z. Huang, H. Schlarb, G. Stupakov, and D. Walz, Phys. Rev. Lett. 92, 074801 (2004).
- [3] S. Reiche, P. Musumeci, C. Pellegrini, and J. B. Rosenzweig, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A 593, 45 (2008).
- [4] Y. Ding et al., Phys. Rev. Lett. 102, 254801 (2009).
- [5] E. L. Saldin, E. A. Schneidmiller, and M.V. Yurkov, Opt. Commun. 239, 161 (2004).
- [6] A. A. Zholents and W. M. Fawley, Phys. Rev. Lett. 92, 224801 (2004).

- [7] A. A. Zholents, Phys. Rev. ST Accel. Beams 8, 040701 (2005).
- [8] A. A. Zholents and G. Penn, Phys. Rev. ST Accel. Beams 8, 050704 (2005).
- [9] E. L. Saldin, E. A. Schneidmiller, and M.V. Yurkov, Phys. Rev. ST Accel. Beams 9, 050702 (2006).
- [10] W. M. Fawley, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A 593, 111 (2008).
- [11] A. A. Zholents and M. S. Zolotorev, New J. Phys. 10, 025005 (2008).
- [12] D. Xiang, Z. Huang, G. Stupakov, Phys. Rev. ST Accel. Beams 12, 060701 (2009).
- [13] Y. Ding, Z. Huang, D. Ratner, P. Bucksbaum, H. Merdji, Phys. Rev. ST Accel. Beams 12, 060703 (2009).
- [14] T. Tanaka, Phys. Rev. Lett. 110, 084801 (2013).
- [15] D. J. Dunning, B. W. J. McNeil and N. R. Thompson, Phys. Rev. Lett. 110, 104801 (2013).
- [16] L. H. Yu, Phys. Rev. A 44, 5178 (1991).
- [17] I. Ben-Zvi, K. M. Yang, and L. H. Yu, Nucl. Instrum. Methods A 318, 726 (1992).
- [18] G. Geloni, V. Kocharyan, and E. Saldin, DESY 10-004.
- [19] E. J. Takahashi, P. Lan, O. D. Muecke, Y. Nabekawa, and K. Midorikawa, Nat. Commun. 4, 2691 (2013).
- [20] T. Tanaka, Phys. Rev. Lett. 114, 044801 (2015).